

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成24年8月9日(2012.8.9)

【公開番号】特開2010-134064(P2010-134064A)

【公開日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【年通号数】公開・登録公報2010-024

【出願番号】特願2008-308226(P2008-308226)

【国際特許分類】

G 03 F 7/20 (2006.01)

H 01 L 21/027 (2006.01)

【F I】

G 03 F 7/20 501

H 01 L 21/30 529

H 01 L 21/30 514 E

【手続補正書】

【提出日】平成23年12月6日(2011.12.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板を支持するステージと、

前記基板に投影する露光パターンを生成するパターン生成部と、

前記パターン生成部で生成された露光パターンを前記基板に縮小投影する対物レンズと

、前記対物レンズを介して前記基板を観察する観察光学系と、

前記基板に応じて前記パターン生成部を制御する制御部と、

を有することを特徴とするマスクレス露光観察装置。

【請求項2】

請求項1記載のマスクレス露光観察装置において、

前記パターン生成部は、

反射角変更可能なマイクロミラーを複数有するDMDと、

前記DMDに露光光を照射する露光照明光学系と、

を有することを特徴とするマスクレス露光観察装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2記載のマスクレス露光観察装置において、

前記観察光学系は、前記パターン生成部で生成された露光パターンを前記基板に縮小投影した状態で前記基板を観察可能に構成されていることを特徴とするマスクレス露光観察装置。

【請求項4】

請求項1ないし請求項3のいずれか1項記載のマスクレス露光観察装置において、

前記基板にレジストを塗布するスピンドルと前記レジストを現像する現像機との少なくとも一方を有していることを特徴とするマスクレス露光観察装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

第1の発明のマスクレス露光観察装置は、基板を支持するステージと、前記基板に投影する露光パターンを生成するパターン生成部と、前記パターン生成部で生成された露光パターンを前記基板に縮小投影する対物レンズと、前記対物レンズを介して前記基板を観察する観察光学系と、前記基板に応じて前記パターン生成部を制御する制御部とを有することを特徴とする。